PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-107120

(43)Date of publication of application: 10.04.2002

(51)Int Cl

G01B 11/06 B23K 26/00 B23K 26/04 H01S 3/00

(21)Application number: 2000-302482

(71)Applicant : SUMITOMO HEAVY IND LTD

(22)Date of filing: 02

02.10.2000

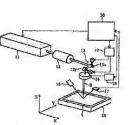
(72)Inventor: HAYASHI KENICHI

(54) POSITION DETECTOR FOR SURFACE AND REAR, AND APPARATUS AND METHOD FOR MARKING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a position detector for the surface and the rear, which can be applied to a marking apparatus which hardly damages the rear of an object to be marked.

SOLUTION: A bolding base holds the object having a surface and a rear. Using a light source, a light-beam flux is made incident on the object held by the holding base from the side of the surface obliquely with respect to the surface. The light-beam flux emitted from the light source is reflected by the surface of the object, held by the holding base, and it turns into a first reflected light. It is refracted by the surface of the object, reflected by the rear of the object, refracted again by the surface of the object, and turns into a second reflected light. The first reflected light and the second reflected that are incident on the light-receiving face of a photodetector. The photodetector detects the position of a beam spot by the first reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the sirst reflected light and that of a beam spot by the scond reflected light on the light-reseiving face.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出辦公開發号 特開2002-107120

(P2002-107120A) (43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコート*(参考)
G01B 11	1/06	G 0 1 B 11/06	H 2F065
B 2 3 K 26	5/00	B 2 3 K 26/00	B 4E068
26	3/04	26/04	C 5F072
H01S 3	3/00	H 0 1 S 3/00	В

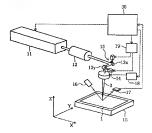
審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特職2000 - 302482(P2000 - 302482)	(71) 出版人 000002107		
		住友重機械工業株式会社		
(22)出顯日	平成12年10月2日(2000.10.2)	東京都品川区北品川五丁目9番11号		
	1,200, 11,710, 11,000	(72)発明者 林 健一		
		神奈川県平塚市夕陽ケ丘63番30号 住友重		
		機械工業株式会社平塚事業所内		
		(74)代理人 100091340		
		弁理士 高橋 敬四郎 (外2名)		
		F ターム(参考) 2F065 AA25 BB22 CC19 DD16 FFD4		
		CC04 HH04 HH12 JJ26 TT02		
		4E068 AB00 CA11 CB08 CC02		
		5F072 AA01 AB01 AB15 AB20 KK30		
		SS08 YY07		

(54) 【発明の名称】 表面及び背面の位置検出装置、マーキング装置、及びマーキング方法

【課題】 マーキング対象物の背面に損傷が生じにくい マーキング装置に適用可能な表面と背面との位置検出装 慌を提供する。

【解決手段】 保持台が、表面及び背面を有する対象物 を保持する。光源が、保持台に保持された対象物に、そ の表面側から光線束を、該表面に対して斜めに入射させ る。光源から出射された光線束が、保持台に保持された 対象物の表面で反射し、第1の反射光となる。さらに、 対象物の表面で屈折し、対象物の背面で反射し、さらに 対象物の表面で再度屈折して第2の反射光となる。第1 及び第2の反射光が、受光装置の受光面に入射する。受 光装置は、受光面上における第1及び第2の反射光のビ 一ムスポットの位置を検出する。



[特許請求の範囲]

【請求項1】 表面及び背面を有する対象物を保持する 保持台と、

前記保持台に保持された対象物に、その表面側から光線 東を、該表面に対して斜めに入射させる光源と、

前記光繁から由榜された光線東が、前記機能台に保持さ れた対象物の表面で取射した第1の反射化、及び舷対線 物の表面で担抗し、該対象物の背面で反射し、さらに該 対象物の表面で再度順折した第2の反射光が入射する受 光面を有し、該受光面上における該第18万第2の反射 光のピームスポットの位置を検出する受光表置とを有す る素面音面位置棒链接端。

【請求項2】 表面と背面とを有するマーキング対象物 を保持する保持台と、

レーザビームを出射するレーザ光源と、

前記レーザ光深から出射したレーザピームを、前配保持 会に保持されたマーキング対象物の表面関から入射させ て該マーキング対象物の内部に集光させ、該マーキング 対象物内における異光位置の深さを変えることができる 集光光学系と

前記保持台に保持されたマーキング対象物に、その表面 側から測定用光線束を、該表面に対して斜めに入射させ る測定用光線と、

前記拠定用光線束が常記保持台に保持された対象物の表面で戻せした第1の反射が、及び流域維制の設面で開発した数分線の可能で反射し、さい底対象物の支面で 再度照折した第2の反射光が入射する受光面を有し、該 受光面における影話。 投び第2の反射光のピームスポットの位置を検出する受光振艇と

約記受光装置で検出された第1及び第2の反射光のビームスポットの位置に基づいて、約記集光光学系により集 たされるレーザビームの集光位置の深さを制御する制御 装置とを有するマーキング装置。

【請求項3】 表面と背面とを有するマーキング対象物に、その表面側から測定用光線束を斜めに入射させる工程と、

前記測性用光線性が前記別得台に保持された資金物の表面では結した第1の反射光、及び該対象物の表面では結し、 該対象物の表面では対した。 さらに 該対象物の表面で 不再度運打した第2の反射光を受光面で受光し、 該受光面 上における該第1及び第2の反射光のビームスポットの 位置から、前記マーキニソグ泉物の表面及び再面の位置を求める工程と、

求められた表面及び背面の位置に基づいて、前記マーキ ング対象物の表面からある深さの位置にレーザビームを 集光させてマーキングを行う工程とを有するマーキング 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、対象物の表面及び sa を検出ことができる。

背面の位置を検出する装置、及びそれを用いて対象物の 内部にマーキングする装置に関する。

[0002]

(従来の技術) 特別平 11-15658 8号公孫に、レーザビー人をマーキング対象物の内部に築光させてクタックを発生させることにより、内部にマーキングを行う方法が即示されている。この方法では、「0レンズにより、レーザビームがマーキング対象物の表面から集光点までの深さを一定に維持することができる。これにより、マーナング対象物の内部の所望の深さの位間にマークを形成することができる。ため、世界半11-15656 8号 公報には、マーキング対象物の指い所望の深さの位間にマークを形成することができる。また、特架平11-15656 8号 公報には、マーキング対象物の屈折平を考慮して、集光点の後さ構定をある方法が掲示されている。

[0003]

(79明が解決しようとする課題] マーキング糸参物の姿 適から集光点までの薬さを豊密に硬むしても、マーキン 分対象物の声面(レーザビーよる人書する側の面には反 対策の面)が関係を受ける場合がある。レーザビームの 集火点がマーキング対象物の内部に位置するにも関わら は、背面でクラックが発生するのは、クラックを発生さ せるために必要となる1パルスあたりのエネルギ密度 (しきい値)が、マーキング対象物の背面において低い ためと考えられる。背面に対いてしるいで動化なくなる測 由として、背面に吸着された微粒子による影響、レーザ ビーエで加熱された保持をに接触することによる影響、

【0004】本発明の目的は、マーキング対象物の背面 に損傷が生じにくいマーキング装置及びマーキング方法 を提供することである。

【0005】本発明の他の目的は、上述のマーキング装置に適用可能な表面と背面との位置検出装置を提供することである。

[0006]

【認題を解決するための手段】本発詞の一規点によると、表面及び背面を有する対象物を保持する保持台と、 表面及び背面を有する対象物を保持する保持台と、 能定保持合に保持された対象体に、その表面側から光線 束を、該方面に対して叙めに入射させる光海と、前記光 集物の当曲者も大党線収が、前記保持台に保持された 集物の表面で反射した第10反射光、及び該対象物の表面で開拓し、該対象物の背面で反射した第10反射光、及び該対象物の表面で展析し、該20原土が大利する受光而を 作し、該20原土上に対7名減五1及び第2の反射外のビームスボットの位置を検討する受光散置とを有する表面 背面位面接触性影響が整理される。

【0007】1本の光線束が、対象物の表面で2本のビームに分割され、この2本のビームが観測される。このため、1つの光源を設置するのみで表面及び背面の位置を輸出ことができる。

【0008】本発明の他の観点によると、表而と背而と を有するマーキング対象物を保持する保持台と、レーザ ビームを出射するレーザ光源と、前記レーザ光源から出 射したレーザビームを、前記保持台に保持されたマーキ ング対象物の表面側から入射させて該マーキング対象物 の内部に集光させ、該マーキング対象物内における集光 位置の深さを変えることができる集光光学系と、前記保 持台に保持されたマーキング対象物に、その表面側から 測定用光線束を、該表面に対して斜めに入射させる測定 用光源と、前記測定用光線束が前記保持台に保持された 対象物の表面で反射した第1の反射光、及び該対象物の 表面で配折し、該対象物の背面で反射し、さらに該対象 物の表面で再度屈折した第2の反射光が入射する受光面 を有し、該受光面上における該第1及び第2の反射光の ビームスポットの位置を検出する受光装置と、前記受光 装置で検出された第1及び第2の反射光のビームスポッ トの位置に基づいて、前記集光光学系により集光される レーザビームの集光位置の深さを制御する制御装置とを 有するマーキング装置が提供される。

【0009】第1及び第2の反射光のビームスポットの 20 位置から、マーキング対象物の表面と背面との位置を決 定することができる。決定された表面及び背面の位置に 基づいてレーザビームの集光位置の深さを制御するた め、より精密な深さ制御が可能になる。

【0010】本発明の他の観点によると、表面と告面と を有するマーキング対象物に、その表面側から測定用光 線束を斜めに入射させる工程と、前記測定用光線束が前 記保持台に保持された対象物の表面で反射した第1の反 射光、及び該対象物の表面で屈折し、該対象物の背面で 反射し、さらに該対象物の表面で再度屈折した第2の反 20 射光を受光面で受光し、核受光面上における核第1及び 第2の反射光のビームスポットの位置から、前記マーキ ング対象物の表面及び背面の位置を求める工程と、求め られた表面及び背面の位置に基づいて、前記マーキング 対象物の表面からある深さの位置にレーザビームを集光 させてマーキングを行う工程とを有するマーキング方法 が提供される。

【0011】 求められた表面及び背面の位置に基づいて レーザビームの集光位置の深さを制御するため、より精 密な深さ制御が可能になる。

[0012]

【発明の実施の形態】図1に、本発明の実施例によるマ ーキング装置の概略図を示す。レーザ光源11が、パル スレーザビームを出射する。レーザ光源11として、例 えばモードロックしたTi:サファイアレーザ発振駅を 用いることができる。Ti:サファイアレーザ発振器 は、例えばパルス幅130fs、波長800nm、平均 出力1W、パルスの繰り返し周波数1kHzのパルスレ ーザビームを出射する。レーザ光源11として、その他 にYAGレーザ発振器、YLFレーザ発振器を用いるこ so 【0020】基準平面20と表面1Fとの間隔をgi、

ともできる。または、これらのレーザ発振器と非線形光 学媒質とを組み合わせて、高調波レーザを生成する各種 レーザ光源を用いることもできる。

【0013】保持台15の上に、マーキング対象物1、 例えばガラス基板が保持されている。マーキング対象物 1は、その表面を上方に向け、背面を保持台15に接触 させるように保持されている。保持台15に保持された マーキング対象物1の表面に平行な面をXY面とし、表 面の法線方向をZ軸とするXYZ直交座標系を考える。 【0014】レーザ光源11から出射されたレーザビー

ムが、ビーム整形器12に入射する。ビーム整形器12 は、レーザビームのビーム断面内のパワー密度分布を所 望の分布に近づけるとともに、断面形状を整形する。 【0015】整形されたレーザビームが、ガルパノスキ ャナ13に入射する。ガルパノスキャナ13は、一対の ガルバノミラー $13 \times$ 及び $13 \times$ を含んで構成される。 ガルパノ制御系19が、ガルパノミラー13x及び13 yの揺動運動を制御する。ガルバノミラー13x及び1 3 v で反射したレーザビームが、 $f \theta$ レンズ 1 4 に入射 する。f θ レンズ 1 4 は、レーザビームを、マーキング 対象物1の内部に集光する。ガルバノスキャナ13は、 レーザビームの光軸を振ることにより、マーキング対象 物1の内部の集光点を、XY面に平行な方向に移動させ ることができる。レンズ駆動装置18が、保持台15か らの f A レンズ 1 4 の高さを調節する。

【0016】制御装置30が、レーザ光源11から出射 するパルスレーザビームのパルスの繰り返しと、ガルバ ノスキャナ13によるレーザビームの光軸走査とを同期 させる。

【0017】観測用レーザ光源16が、マーキング対象 物1の表面に、斜めに観測用レーザビームを入射させ る。観測用レーザ光源16は、例えばHeNeレーザ発 振器等で構成される。受光装置17が、観測用レーザ光 源16から出射されたレーザビームの反射光を受光面で 受光する。受光禁留17は、例えばCCDカメラ等で様 成され、受光面上のビームスポットの位置を検出するこ とができる。

【0018】図2を参照して、受光装置17の受光面上 のビームスポットの位置から、マーキング対象物1の表 面及び背面の位置を求める方法について説明する。

【0019】図2は、マーキング対象物1の表面への観 利用レーザビームの入射面内におけるレーザビームの伝 撇の様子を示す。マーキング対象物1の表面1F及び背 面1Rに平行な基準平面20が定義されている。観測用 レーザビームが、基準平面20で反射したと仮定したと きの、受光面上におけるビームスポットの位置を基準点 Oとする。観測用レーザ光源16、基準平面20、及び 受光装置17の位置が固定されると、受光面上に基準点 Oを決定することができる。

5

基準平面20と背面1Rとの間隔をg2とする。表面1 Fへの振測用レーザビームの入射角をθ:とし、屈折角 を B2 とする。 表面 1 Fで反射した観測用レーザビーム の受光面上のビームスポットの位置を A とする。表面 1 Fで屈折し、背面1Rで反射し、さらに表面1Fで再度 屈折した観測用レーザビームの受光面上のビームスポッ トの位置をBとする。基準点と点Aとの距離をd:と し、点AとBとの距離をd2とする。

【0021】間隔点は、

[0022]

【数1】

 $g_1 = d_1 / (2 t a n \theta_1)$ · · · (1)

と表される。また、マーキング対象物1の屈折率をnと

[0023]

【数2】sin 01/sin 02=n · · · (2) が成立する。間隔 22は、

[0024]

[数3]

 $g_2 = g_1 + d_2 / (2 + a + b_2)$. . . (3) と表される。式(1)~(3)より、81、d1及びd2 が決定されれば、階隔g1及びg2を求めることができ る。すなわち、基準平面20に対する表面1F及び背面 1 Rの相対位置を決定することができる。

【0025】図2で説明した方法では、表面1Fで、1 本のレーザビームを部分反射させることによって2本の ビームに分割し、この2本のビームが観測される。この ため、観測用レーザ光源16を1台準備するのみで、表 面1F及び背面1Rの位置を検出することが可能であ る。

【0026】なお、点AとBとが離れすぎるような場 合、例えば入射角θ:が大きい場合あるいはマーキング 対象物1が厚い場合には、受光装置17とマーキング対 象物1との間に集光レンズ等を配置し、2本のレーザビ 一人の光鞋が徐々に近づけてもよい。この場合には、間 隔 g 1 及び g 2 を計算する際に集光レンズの倍率を考慮す る必要がある。

【0027】図1に戻って説明を続ける。受光装置17 から、ビームスポット位置情報、例えば図2に示した距 離d1及びd2が制御装置30に送信される。制御装置3 40 のは、図2に示した基準平面20に対するマーキング対 象物1の表面1F及び背面1Rの相対位置を求める。こ れにより、レーザビームを集光すべき厚さ方向の位置 (Z座標)が決定される。ここで、集光すべき位置と は、ビーム谷が最小になる位置を意味する。

【0028】求められた位置にレーザビームが集光され るように、レンズ駆動装置 1.8 が、 $f.\theta$ レンズ 1.4 の高 さを護節する。マーキング対象物1の屈折率がnのと き、マーキング対象物1の表面1Fから集光位置までの 深さは、屈折窓を1とした場合の深さのn倍になる。従 so る表面1F及び背面1Rの相対位置が測定されるため、

って、f θ レンズ 1 4 の高さを調節する際には、マーキ ング対象物1の屈折率を考慮することが好ましい。

【0029】上記実施例では、基準平面20に対するマ ーキング対象物1の表面1F及び背面1Rの相対位置を 絵出! その相対位置に基づいてレーザビー人の集光位 置が制御される。このため、マーキング対象物1の厚さ のばらつきに起因する集光位置の深さのずれを防止する ことができる。

【0030】次に、集光位置の好ましい深さについて説 10 明する。マーキング用のレーザビームとして、品質の優 れている TEMoo モードのレーザビームを想定する。ガ ウス确度分布を持つレーザビームを集光したときのスポ ット径dは、

[0031]

【数4】 d=λf/(πD) . . . (4)

となる。ここで、Aは波長、fはレンズの焦点距離、D はレンズへ入射するビームのビーム径である。マーキン グ対象物1の屈折率をn、表面1Fから集光位置までの 深さを s s とすると、表面 1 F 上におけるピームスポッ 20 ト径 d s は、

[0032]

【数5】 dF=n SF/ (f D) . . . (5)

となる。ここでは、集光位置におけるビームスポットが 無限小であると仮定した。同様に、背面1 R から集光位 置までの深さを 5 x とすると、背面 1 R 上におけるビー ムスポット径deは、

[0033]

[
$$\&6$$
] $d_R = n s_R / (f D) \cdots (6)$

【0034】マーキング対象物1の表面1F及び背面1 Rにクラックが発生するのを防止するために、表面1F 及び背面1Rにおけるレーザビームのエネルギ密度を、 クラックが発生するしきい値よりも小さくする必要があ る。本願発明者の行った領々の実験によると、背面1R におけるしきい値が、表面1Fにおけるしきい値の約2 /3であることがわかった。すなわち、表面1Fよりも 背面1Rにおいてクラックが発生しやすい。

【0035】 レーザビームの新面内のエネルギ密度は、 ビームスポット径の自乗に反比例する。従って、表面1 F及び背面 I Rのいずれにおいてもクラック発生のしき い値を超えず、かつ集光位置においてクラックが発生す るしきい値を超えるためには、

[0036]

【数7】
$$d_F/d_R = (2/3)^{1/2}$$
 ・・・ (7)
とすることが好ましい。式 (5) ~ (7) から、

[0037] 【数8】 SF/ SR= (2/3) 1/2 · · · (7)

とすればよいことがわかる。 【0038】図2に示したように、基準平面20に対す 深さ s r 及び s g が式 (7) を満たすように、f θ レンズ 1 4 の高さを調節する C とができる。

【0039】上記実施例では、マーキング対象物の内部 にクラックを発生させることによりマーキングを行う場合 合を影明したが、クラックを発生させることなく。 独位画の服託率を変化させることによりマーキングを行う ことも可能である。この総合にも、マーキングを続う 支通11をび作所18の位置を施定し、その値量に基 づいて集光位置の深さを似尊することにより、表面1F 及び背面1Rに対象を多くることなくマーキングを行う ことが可能になっ

【0040】以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であるう。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、 1本の測定用光線束を照射することにより、対象物の表 五と背面との双方の位置を検出することができる。検出 された表面と背面の位置に落づいて、レーザビームの集 2 光位置の深さを調節することにより、対象物の厚さのば らつき等による位置ずれを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるレーザマーキング装置の 概略を示す斜視図である。

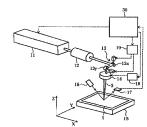
【図2】表面及び背面の位置を検出方法を説明するため の図である。 【符号の説明】

1 マーキング対象物

11 レーザ光源

- 11 レーザ光源 12 ビーム整形器
 - 13 ガルバノスキャナ
 - 14 「 のレンズ
 - 15 保持台
 - 16 観測用レーザ光源
 - 17 受光装置
- 18 レンズ駆動装置
- 19 ガルパノ制御装置 20 基準平面
- 3.0 制御装置

[301]



[図2]

